

REIVINDICACIONES

1. Un aparato de espejo anti-vaho (1) que comprende:
 - un sustrato reflectante (100a); y
 - un complejo anti-vaho (300a) acoplado al sustrato reflectante (100a), el complejo anti-vaho (300a) comprendiendo:
 - o una capa adhesiva térmicamente activada (220a) encima del sustrato reflectante (100a);
 - o una primera capa polimérica (240a) que comprende un polímero termoplástico, la primera capa polimérica (240a) estando encima de la capa adhesiva térmicamente activada; y
 - o una segunda capa polimérica (260a) encima de la primera capa polimérica (240a);en donde la relación de grosor entre la capa adhesiva térmicamente activada (220a) y la primera capa polimérica (240a) es de 1.25:1 a 2.75:1.
2. El aparato de espejo anti-vaho (1) de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el aparato de espejo tiene una relación de rayón/poro entre 120/80 y 10/5.
3. El aparato de espejo anti-vaho (1) de conformidad con la reivindicación 1 o 2, caracterizado porque el complejo anti-vaho (300) tiene un grosor de 250 μm a 300 μm .
4. El aparato de espejo anti-vaho (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la capa adhesiva térmicamente activada (220a) está libre de un aditivo UV.
5. El aparato de espejo anti-vaho (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el complejo anti-vaho (300) está libre de un aditivo UV.
6. El aparato de espejo anti-vaho (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la primera capa polimérica (240a) tiene un grosor de 75 μm a 125 μm .
7. El aparato de espejo anti-vaho (1) de conformidad con cualquiera de las

reivindicaciones anteriores, caracterizado porque además comprende una capa protectora encima de la segunda capa polimérica (260a).

8. El aparato de espejo anti-vaho (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la segunda capa polimérica (260a) comprende un poliuretano.
9. El aparato de espejo anti-vaho (1) de conformidad con la reivindicación 8, caracterizado porque la segunda capa polimérica (260a) además comprende un polímero hidrofílico.
10. El aparato de espejo anti-vaho (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el complejo anti-vaho (300) es ópticamente claro.
11. Un aparato de espejo anti-vaho (1), que comprende:
 - un sustrato reflectante (100b); y
 - un complejo anti-vaho (300b) que comprende:
 - una capa adhesiva sensible a la presión (220b) encima del sustrato (100b);
 - una primera capa polimérica (240b) que comprende un polímero termoplástico, la primera capa polimérica (240b) encima de la capa adhesiva sensible a la presión (220b); y
 - una segunda capa polimérica (260b) encima de la primera capa polimérica (240b);en donde la relación de grosor entre la capa adhesiva sensible a la presión (220b) y la primera capa polimérica (240b) varía de 0.25:1 a 1.25:1.
12. El aparato de espejo anti-vaho (1) de conformidad con la reivindicación 11, caracterizado porque la capa adhesiva sensible a la presión (220b) tiene un grosor que varía de 10 μm a 40 μm .
13. El aparato de espejo anti-vaho (1) de conformidad con la reivindicación 11 o 12, caracterizado porque la segunda capa polimérica (260b) comprende un poliuretano.
14. Un método para preparar un aparato espejo que comprende:

- a) suministrar un sustrato reflectante
 - b) suministrar una película de múltiples capas que comprende:
 - una capa protectora; y
 - un complejo anti-vaho que comprende:
 - una primera capa polimérica;
 - una capa adhesiva; y
 - una segunda capa polimérica;
 - c) laminar la película de múltiples capas y el sustrato reflectante juntos para formar un compuesto laminado;
 - d) mantener el compuesto laminado en un entorno ambiental durante 48 a 72 horas para permitir la solidificación de la película de múltiples capas;
 - e) remover la capa protectora del compuesto laminado para exponer el complejo anti-vaho; y
 - f) realizar una fase de limpieza post-laminación.
- 15.El método de acuerdo con la reivindicación 14, en donde la fase de limpieza post-laminación comprende un primer paso de limpieza y un segundo paso de limpieza.
- 16.El método de acuerdo con la reivindicación 15, en donde el segundo paso de limpieza se realiza por lo menos 24 horas después de completar el primer paso de limpieza.
- 17.El método de acuerdo con la reivindicación 15, en donde el primer paso de limpieza comprende aplicar una composición a base de alcohol al complejo anti-vaho.
- 18.El método de acuerdo con las reivindicaciones 15 a 17, en donde el primer paso de limpieza además comprende aplicar una solución alcalina al complejo anti-vaho.
- 19.El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 15 a 18, en donde el segundo paso de limpieza comprende aplicar una composición a base de alcohol al complejo anti-vaho.
- 20.El método de acuerdo con la reivindicación 19, en donde el segundo paso de limpieza además comprende aplicar una solución alcalina al complejo anti-

vaho.

21. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 14 a 20, en donde el sustrato reflectante y la película de múltiples capas se laminan juntos usando un laminador de rollo en caliente.
22. El método de acuerdo con la reivindicación 21, en donde el laminador de rollo en caliente tiene una velocidad de operación de 1 pie/minuto (0,305 metros/minuto) a 10 pies/minutos (3,05 metros/minuto).
23. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 14 a 22, en donde la película de múltiples capas y el sustrato reflectante se laminan juntos para formar un compuesto laminado a una presión de 10 psi (68,9 kPa) a 40 psi (275,8 kPa).
24. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 14 a 23, en donde la película de múltiples capas se mantiene a una tensión de 15 libras (66,7 N) a 30 libras (133,4 N) durante el paso de laminación.
25. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 21 a 24, el laminador de rollo en caliente se mantiene a una temperatura de 105°C a 130°C durante el paso de laminación.

P-13427

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2017/0005104**
Solicitud de patente a nombre de **MCS INDUSTRIES INC.**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de la sociedad MCS INDUSTRIES INC., domiciliada en Pensilvania, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **4880** notificado electrónicamente el 19 de junio de 2019, relacionado con los requerimientos de fondo de la solicitud, atentamente me permito presentar la siguiente información:

1. Modificación a las Reivindicaciones

Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de veinticinco (25) reivindicaciones y reemplaza completamente el presentado anteriormente. Específicamente, se realizaron las siguientes modificaciones:

- 1.1** Se modificaron las reivindicaciones 3, 5 y 10 con el propósito de indicar el número de referencia del complejo anti-vaho como 300.
- 1.2** Se modificaron las reivindicaciones 22, 23 y 24 con el propósito de indicar los decimales mediante coma (,).

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de presentar la invención de forma más clara.

2. Pago de tasas

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por concepto de reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene igual número de reivindicaciones que el anteriormente presentado, y en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad.

3. Claridad y concisión de las reivindicaciones

El solicitante manifiesta que mediante la presentación del nuevo capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico. En relación con las diferentes objeciones formuladas, se desea mencionar lo siguiente:

- 3.1** Su Despacho ha indicado, “[l]a expresión “(...) capa polimérica (...) polímero termoplástico” (reiv. 11) es de carácter general que sugiere de forma imprecisa que la protección se extiende a posibles variaciones o modificaciones, por lo cual, no permiten distinguir la invención del estado de la técnica”. En dicho respecto, el solicitante respetuosamente reitera que de acuerdo con lo establecido en el Manual Andino de Patentes (MAP) y la Guía de Examen de Solicitudes de Patente y Modelos de Utilidad de la SIC, el lenguaje utilizado en una solicitud de patente debe ser el lenguaje común del campo técnico relacionado y su significado y alcance en las reivindicaciones, debe ser el que normalmente se da en el área técnica de la solicitud, siendo claro para la persona versada en la materia con su sola lectura, lo que cumple a cabalidad la presente solicitud. Así las cosas, las reivindicaciones de la presente solicitud son lo suficientemente claras y concisas precisando la materia reclamada, pues el uso de términos como “(...) capa polimérica (...) polímero termoplástico” (reiv. 11) a la luz del Capítulo Descriptivo, resultan completamente reconocibles por cualquier persona medianamente versada en la materia.

Además, tal como se establece en el Artículo 51, Capítulo V de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, “*El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. **La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas**”, por lo que el experto en la técnica al momento de reproducir la invención no sólo puede, sino que también **debe***

recurrir a la memoria descriptiva y dibujos para interpretar en caso que sea necesario, la materia reclamada.

En conclusión, una persona medianamente versada en la materia puede entender perfectamente el alcance y los límites de la protección solicitada, entendiendo qué elementos estructurales deben usarse para reproducir el invento y cuáles elementos están cobijados por las reivindicaciones y cuáles no.

Adicionalmente, un inventor está en su derecho de reclamar protección **para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado sin importar la amplitud de éste, siempre y cuando se guarde unidad de invención**. Así las cosas, respetuosamente se considera errada la objeción que el Examinador presenta en relación con los términos objetados, pues estos indican claramente y de manera directa qué tipo de característica estructural debe estar incluida en la invención reclamada.

Esto es, dentro del concepto inventivo desarrollado se contemplan modalidades sin apartarse del espíritu y alcance de la materia reivindicada. De nuevo, una persona versada en la materia puede entender perfectamente el alcance y los límites de la protección solicitada con base en la información divulgada en el Capítulo Descriptivo. Por lo demás, vale la pena anotar que el uso de estos términos y otros análogos que indican la posibilidad de obtener la invención en diversas modalidades, es una práctica aceptada a nivel mundial en el ámbito de las patentes, ya que como el examinador debe saberlo, una patente de invención **no se limita** a una única modalidad, sino que cubre un concepto inventivo **global** que abarca diferentes modalidades (diversas materializaciones de la invención), ligadas por un efecto técnico común que finalmente delimita el alcance de la invención. Así las cosas, respetuosamente se insiste que los términos objetados son perfectamente entendibles por cualquier persona medianamente versada en la materia, de tal manera que a la luz del Capítulo Descriptivo es perfectamente claro el alcance y los límites de la protección solicitada, entendiendo cuáles materializaciones están cobijadas por las reivindicaciones y cuáles no.

Asimismo, se informa a esta Superintendencia que los términos objetados por el examinador no llevarían a que un experto con nivel medio en la materia se vea confundido sobre el alcance de la invención definida en las reivindicaciones, sino que por el contrario dicho experto podría saber qué desea proteger el solicitante, hecho que se puede demostrar gracias al examen de patentabilidad detallado

realizado por el examinador en su concepto técnico (puntos 4 y 5 del Oficio No. 4880), ya que si lo que aduce el Examinador fuese cierto con respecto a que *“la protección se extiende a posibles variaciones o modificaciones, por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica”*, entonces el Examinador no hubiera estado en capacidad de realizar un análisis detallado del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, ni tampoco hubiese podido llegar a la conclusión de la supuesta falta de novedad de las antiguas reivindicaciones 11, 12 y 13.

Dado lo anterior, los términos objetados por el examinador se mantienen, ya que los mismos **no afectan** la claridad de la invención y el experto con nivel medio en la materia puede entender lo que se desea proteger y el alcance de dicha protección, tal como se indicó previamente.

En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capítulo reivindicatorio, que incluye veinticinco (25) reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

4. Novedad

El examinador establece en su concepto técnico la falta de novedad de las antiguas reivindicaciones 11, 12 y 13 a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en el documento US20080187728 (D1).

En este sentido, me permito decir que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Esto significa que para que un documento del estado de la técnica pueda afectar la novedad de una solicitud, deberá revelar todas y cada una de las características técnicas que la definen.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese Despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica, específicamente en el documento D1, de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en el nuevo capítulo reivindicatorio.

Considerando la anterior definición, es deseo del solicitante manifestar que la invención reclamada en el nuevo capítulo reivindicatorio es novedosa en relación con el estado de la técnica citado, por las siguientes razones:

Contrario a las afirmaciones del examinador, D1 no enseña una capa anti-vaho. Más bien, en el mejor de los casos, el Párrafo [0003] de D1 establece:

"Cuando una superficie más fría entra en contacto con aire húmedo más cálido, puede producirse condensación en la superficie más fría. Dependiendo de las diferencias de temperatura, la condensación puede tomar la forma de niebla o escarcha en la superficie y, particularmente con superficies sustancialmente transparentes, afectar la transmisión de luz y afectar la visibilidad".

Esta declaración de D1 no logra establecer que la capa anti-escarcha sea capaz de funcionar también como una capa anti-vaho a temperaturas elevadas. Más bien, la declaración del Párrafo [0003] de D1 simplemente establece bajo qué condiciones se puede formar niebla en una superficie. Esta declaración de D1 no debe interpretarse erróneamente como una enseñanza de qué composiciones son capaces de eliminar dicha niebla de una superficie. Además, la declaración en el Párrafo [0020] nuevamente se da sólo en referencia explícita a la escarcha. El hecho de que D1 incluso haga referencia a temperaturas tan altas como 65°C, sin discutir el empañamiento, sólo fortalece la posición del solicitante respecto a que D1 **NO** enseña una capa anti-vaho. Es incorrecto realizar saltos no admitidos entre el rendimiento anti-escarcha de referencia explícita en D1 y la capa anti-vaho de la reivindicación 11. Por al menos esta razón, la objeción realizada a la materia reclamada en la reivindicación independiente 11 y sus dependientes no es apropiada.

Incluso si se mantiene que la capa anti-escarcha de D1 cumple de alguna manera con el complejo anti-vaho de la reivindicación 11 de esta solicitud, lo cual **no hace**, la reivindicación 11 también requiere "una primera capa polimérica que comprende un **polímero termoplástico**, la primera capa polimérica encima de la capa adhesiva sensible a la presión (...)". Con esto en mente, D1 no puede enseñar o sugerir remotamente que la capa de policarbonato (o cualquier otra capa), comprende polímero termoplástico.

Por lo tanto, al menos por esta razón, la objeción realizada a la reivindicación independiente 11 - y sus dependientes - como falta de novedad sobre D1 no es

apropiada. De este modo, el solicitante respetuosamente solicita que se retire la objeción a las reivindicaciones 11-13 por falta de novedad sobre D1.

De esta forma, las nuevas reivindicaciones 1 a 25 cumplen con el requisito de novedad, tal como se define en el artículo 16 de la Decisión 486 y como se explica detalladamente en el Manual Andino y la Guía para Examinadores de la Superintendencia de Industria y Comercio.

5. Conclusión

Con las modificaciones introducidas y los argumentos presentados puede concluirse que:

- i) La presente solicitud es clara, concisa y está debidamente soportada en la descripción, cumpliendo con los requerimientos del Artículo 30 de la Decisión 486; y
- ii) Las reivindicaciones actuales son patentables sobre D1, cumpliendo así con los requerimientos del Artículo 16 de la Decisión 486.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo- y 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que señala que: *"habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión, que será motivada. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la actuación por el peticionario y por los terceros reconocidos"*, (el subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese Despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

6. Anexos

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por veinticinco (25) reivindicaciones.

Señor Director,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

REIVINDICACIONES

1. Un aparato de espejo anti-vaho (1) que comprende:
 - un substrato reflectante (100a); y
 - un complejo anti-vaho (300a) acoplado al substrato reflectante (100a), el complejo anti-vaho (300a) comprendiendo:
 - o una capa adhesiva térmicamente activada (220a) encima del substrato reflectante (100a);
 - o una primera capa polimérica (240a) que comprende un polímero termoplástico, la primera capa polimérica (240a) estando encima de la capa adhesiva térmicamente activada; y
 - o una segunda capa polimérica (260a) encima de la primera capa polimérica (240a);en donde la relación de grosor entre la capa adhesiva térmicamente activada (220a) y la primera capa polimérica (240a) es de 1.25:1 a 2.75:1.
2. El aparato de espejo anti-vaho (1) de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el aparato de espejo tiene una relación de rayón/poro entre 120/80 y 10/5.
3. El aparato de espejo anti-vaho (1) de conformidad con la reivindicación 1 o 2, caracterizado porque el complejo anti-vaho (300) tiene un grosor de 250 μm a 300 μm .
4. El aparato de espejo anti-vaho (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la capa adhesiva térmicamente activada (220a) está libre de un aditivo UV.
5. El aparato de espejo anti-vaho (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el complejo anti-vaho (300) está libre de un aditivo UV.
6. El aparato de espejo anti-vaho (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la primera capa polimérica (240a) tiene un grosor de 75 μm a 125 μm .
7. El aparato de espejo anti-vaho (1) de conformidad con cualquiera de las

reivindicaciones anteriores, caracterizado porque además comprende una capa protectora encima de la segunda capa polimérica (260a).

8. El aparato de espejo anti-vaho (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la segunda capa polimérica (260a) comprende un poliuretano.
9. El aparato de espejo anti-vaho (1) de conformidad con la reivindicación 8, caracterizado porque la segunda capa polimérica (260a) además comprende un polímero hidrofílico.
10. El aparato de espejo anti-vaho (1) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el complejo anti-vaho (300) es ópticamente claro.
11. Un aparato de espejo anti-vaho (1), que comprende:
 - un sustrato reflectante (100b); y
 - un complejo anti-vaho (300b) que comprende:
 - una capa adhesiva sensible a la presión (220b) encima del sustrato (100b);
 - una primera capa polimérica (240b) que comprende un polímero termoplástico, la primera capa polimérica (240b) encima de la capa adhesiva sensible a la presión (220b); y
 - una segunda capa polimérica (260b) encima de la primera capa polimérica (240b);en donde la relación de grosor entre la capa adhesiva sensible a la presión (220b) y la primera capa polimérica (240b) varía de 0.25:1 a 1.25:1.
12. El aparato de espejo anti-vaho (1) de conformidad con la reivindicación 11, caracterizado porque la capa adhesiva sensible a la presión (220b) tiene un grosor que varía de 10 μm a 40 μm .
13. El aparato de espejo anti-vaho (1) de conformidad con la reivindicación 11 o 12, caracterizado porque la segunda capa polimérica (260b) comprende un poliuretano.
14. Un método para preparar un aparato espejo que comprende:

- a) suministrar un sustrato reflectante
- b) suministrar una película de múltiples capas que comprende:
 - una capa protectora; y
 - un complejo anti-vaho que comprende:
 - una primera capa polimérica;
 - una capa adhesiva; y
 - una segunda capa polimérica;
- c) laminar la película de múltiples capas y el sustrato reflectante juntos para formar un compuesto laminado;
- d) mantener el compuesto laminado en un entorno ambiental durante 48 a 72 horas para permitir la solidificación de la película de múltiples capas;
- e) remover la capa protectora del compuesto laminado para exponer el complejo anti-vaho; y
- f) realizar una fase de limpieza post-laminación.

15.El método de acuerdo con la reivindicación 14, en donde la fase de limpieza post-laminación comprende un primer paso de limpieza y un segundo paso de limpieza.

16.El método de acuerdo con la reivindicación 15, en donde el segundo paso de limpieza se realiza por lo menos 24 horas después de completar el primer paso de limpieza.

17.El método de acuerdo con la reivindicación 15, en donde el primer paso de limpieza comprende aplicar una composición a base de alcohol al complejo anti-vaho.

18.El método de acuerdo con las reivindicaciones 15 a 17, en donde el primer paso de limpieza además comprende aplicar una solución alcalina al complejo anti-vaho.

19.El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 15 a 18, en donde el segundo paso de limpieza comprende aplicar una composición a base de alcohol al complejo anti-vaho.

20.El método de acuerdo con la reivindicación 19, en donde el segundo paso de limpieza además comprende aplicar una solución alcalina al complejo anti-

vaho.

- 21.El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 14 a 20, en donde el sustrato reflectante y la película de múltiples capas se laminan juntos usando un laminador de rollo en caliente.
- 22.El método de acuerdo con la reivindicación 21, en donde el laminador de rollo en caliente tiene una velocidad de operación de 1 pie/minuto (0,305 metros/minuto) a 10 pies/minutos (3,05 metros/minuto).
- 23.El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 14 a 22, en donde la película de múltiples capas y el sustrato reflectante se laminan juntos para formar un compuesto laminado a una presión de 10 psi (68,9 kPa) a 40 psi (275,8 kPa).
- 24.El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 14 a 23, en donde la película de múltiples capas se mantiene a una tensión de 15 libras (66,7 N) a 30 libras (133,4 N) durante el paso de laminación.
- 25.El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 21 a 24, el laminador de rollo en caliente se mantiene a una temperatura de 105°C a 130°C durante el paso de laminación.